

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年5月16日(16.05.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/069720 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 57/00 (2006.01) *B24B 37/00* (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/078942
- (22) 国際出願日: 2012年11月8日(08.11.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-245153 2011年11月9日(09.11.2011) JP
- (71) 出願人: DOWAエコシステム株式会社(DOWA ECO-SYSTEM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1010021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 上原 大志(UEHARA, Taishi); 〒1010021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 DOWAエコシステム株式会社内 Tokyo (JP). 藤田 浩示(FUJITA, Koji); 〒1010021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 DOWAエコシステム株式会社内 Tokyo (JP). 本間 善弘(HONMA, Yoshihiro); 〒1010021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 DOWAエコシステム株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 津国 外(TSUKUNI & ASSOCIATES et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: RECYCLING METHOD FOR POLISHING AGENT

(54) 発明の名称: 研磨剤リサイクル方法

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a recycling method which achieves a high removal efficiency for a silicon component and an aluminum component and thus makes it possible to recover simply a polishing agent having polishing performance equivalent to that of a fresh polishing agent from a spent cerium oxide-based glass-polishing agent. A recycling method for recovering a polishing agent from a spent cerium oxide-based glass-polishing agent, including adjusting the pH of a spent cerium oxide-based glass-polishing agent slurry to 0.5 to 3.0.

(57) 要約: 珪素成分やアルミニウム成分の除去率が高く、使用前の新品の研磨剤と同等の研磨性能を有する研磨剤を簡便に使用済み酸化セリウム系ガラス研磨剤からリサイクルする方法を提供することを目的とする。使用済み酸化セリウム系ガラス研磨剤から研磨剤をリサイクルする方法であって、使用済み酸化セリウム系ガラス研磨剤のスラリーのpHを0.5～3.0の範囲に調整することを含む方法。



WO 2013/069720 A1